金屬薄膜的量子尺寸效應

摘要

當金屬薄膜厚度變得越來越薄的時候,它們 的基本性質受到量子力學效應的影響越來越顯 著,譬如功函數、表面能等性質會隨著薄膜厚度 產生明顯的振盪現象,而且振盪的週期可由塊材 費米能面垂直於薄膜表面的波向量決定。這個有 趣的發現顯示長久以來學界使用於模擬表面研 究的超晶格方法,由於使用模擬表面之原子層數 偏低,往往無法得到正確地理論計算結果。

一、前 言

長久以來,在半導體上成長出具有原子平整 度(atomic flatness)的金屬薄膜,一直是表面科學 研究重要的領域之一,其主要原因除了科學上的 興趣與探索之外,也因爲這方面的基礎研究具有 應用上的潛力及價值。然而由於金屬與半導體的 晶格常數往往極不一致(不具有簡單的整數比關 係),導致在金屬與半導體界面存在著不可避免 的應力(stress),因此金屬成長經常會形成三維的 山丘結構而非平坦的薄膜;基於這原因,要在半 導體上產生平坦的金屬薄膜,一直是相當困難的 目標。然而近幾年來,在金屬生長於半導體磊晶 現象研究上,發現到一個極為有趣而且沒有預期 到的現象。首先 Smith 等人[1]利用低溫蒸鍍再回 溫的方法,成功地成長出具有原子平整度的銀薄 膜在 GaAs(110)的表面, 這方面的研究開始出現 突破,隨後在 Ag/Si(111) [2]及 Pb/Si(111) [3-5]等 系統都發現到這種有趣的現象。

在 Ag 成長於 GaAs (110)的系統,銀薄膜的 成長具有七個原子層的臨界厚度(critical thickness),即使銀的蒸鍍量低於七個單層,薄膜 的厚度依然是七個原子層,唯薄膜間會有空洞出 現。這種新的成長模式,由 Zhang 等人[6]的理 論計算得到初步的解釋,他們認爲這種成長模式 的起源在於電子受限於薄膜內引起的量子尺寸 效應(quantum size effect) [7],亦即是銀薄膜中的 中央研究院原子與分子科學研究所 魏金明

電子的波向量在垂直表面方向被量子化 (quantized),這種效應驅使銀原子排列成平坦的 表面,進而導致銀薄膜具有臨界厚度,並將這種 因電子效應產生的成長行為模式稱作 electronic growth,以有別於傳統成長模式。Gavioli等人[2] 亦發現在 Si(111)7×7 表面上也可成長出平坦並 具有臨界厚度的銀薄膜,更進一步證實低溫蒸鍍 是在半導體上形成平坦薄膜的有效方法。然而目 前研究最透徹的系統是鉛在低溫下 Si(111)7×7 表面的成長[3-5,8-9],由於這個系統的量子尺寸 效應是如此的強,因此產生許多令人驚訝的有趣 現象。首先鉛在Si(111)7×7表面形成鉛的wetting layer 之後,便直接形成表面平坦且邊緣陡峭七 個原子層的島嶼結構,而隨著鉛蒸鍍量的增加, 島嶼的厚度不變,只有島嶼面積隨之增加,呈現 二維的成長行為,這些成長的特徵明顯反映出鉛 島的形成機制,亦是起源於量子尺寸效應。更令 人感到有趣的是即使在低溫的情況下,鉛島的層 數與厚度都呈現出雙層增加(bilayer increament) 的現象[4],而利用低溫電子掃瞄穿隧顯微鏡 (scanning tunneling microscopy)量測靠近費米能 階的電子量子態,也出現依賴鉛島層數 even-odd 不同的振盪現象[5,8]。以上所敘述的實驗結果基 本上都是使用自由電子氣的果醬模型(freeelectron-like jellium model)來分析及解釋。

當薄膜的厚度逐漸變薄至奈米尺寸時,量子 局限(quantum confinement)效應對系統的物理性 質,可以預期會產生重大的影響。首先在垂直於 薄膜表面的 z 方向上,電子被限制在有限區域 內,因而形成能量分離的量子井態[10],若考慮 自由電子氣模型,其在 xy 方向上的能量色散關 係為拋物線,因此可形成一系列與量子井態相關 的次能帶(energy subband)。當薄膜厚度增加時, 費米能階上的次能帶開始逐一地與費米能階相 交,並掉落在費米能階以下,薄膜系統的物理性 質因此隨著厚度增加而產生週期性的振盪現 象。然而實際上金屬薄膜的厚度是不連續的,而



且在平行於薄膜的方向上,有晶體的能帶效應 (crystal band structure effect),為了能夠對『金屬 薄膜的量子尺寸效應』有一個定量而毫無疑慮的 深入理解,使用密度泛函理論為基礎的第一原理 計算方法,來探討並研究這些有趣的金屬薄膜系 統,顯然是無法避免的。以下我將討論利用電子 密度泛函理論計算得到的 Pb(111)[11]及 Al(111) [12]等兩個金屬薄膜系統的結果,最後再做一個 簡單的總結。

圖一左邊顯示的是 Pb(111)薄膜在Γ點量子 井態能階(相對於費米能階)位置,隨著薄膜厚度 增加的函數,圖一右邊則是 Pb 塊材(bulk)費米能 面垂直於薄膜表面(111)方向,在Γ點的能量色散 (energy dispersion)關係。觀察圖一,可以發現塊 材能量色散範圍限定薄膜量子井態存在的範 圍,*s-p*的能隙間隔是4 eV,而且決定薄膜性質 的量子井態是來自於*p*能帶。如果將這些*p*能帶 量子井態的能階,如圖一的分類連接起來,可以 發現到大約薄膜厚度每增加 2.2 層,就有一個未 佔據的量子井態與費米能階相交,而掉到費米能 階以下形成佔據態,這與實驗上觀察到鉛島厚度 呈現出雙層增加的現象,互相一致。

對 *s-p* 金屬而言,量子井態的能階可以用以下的量子化條件(quantization condition)來描述:

 $2k(\varepsilon)Nd + 2\Phi(\varepsilon) = n2\pi$

這裡 k 是在能帶中相對於能量 ε 的波向量, N 是 薄膜的原子層數, d 是原子層間的距離, n 是從 0 開始的整數, $\Phi(\varepsilon)$ 是電子波函數在薄膜及真空



膜的功函數,兩者都呈現週期約為 2.2 層 的振盪現象

界面的相位移(phase shift)。使用這個關係式,可 計算出未佔據量子井態與費米能階相交形成佔 據態的週期如下:

 $\Delta N = \pi / (k_F d)$

這裡的 k_F 是費米波向量。從圖一右邊,將 k_F 對 L 做測量,可得到 k_F 為 0.45(π/d),因此 ΔN = 2.2,這與圖一左邊薄膜厚度每增加 2.2 層,就有 一個未佔據量子井態與費米能階相交,進而形成 佔據態的現象互相一致。以上的分析,提示 2.2 層的振盪週期應該存在於薄膜的各種相關物理 性質,譬如:表面能、功函數及表面鬆弛(surface relaxation)…等等。

圖二顯示 Pb(111)薄膜的表面能及功函數, 兩者都呈現週期約為 2.2 層的振盪現象,這是由 $\hbar(k_F d/\pi)$ 非常靠近可以產生完美地 even-odd 振 盪的數值(1/2)的緣故。令人驚異的是這個系統量 子尺寸的效應是如此的強,即使薄膜厚度在 20 層(亦即 5.6 奈米)以上,仍可以清楚地看到 evenodd 的振盪現象。除了表面能、功函數之外, Pb(111)薄膜的表面鬆弛也有類似 even-odd 的振 **盪現象**(見圖三),包括薄膜表面的第一間距 (d₁₂)、第二間距(d₂₃)及第三間距(d₃₄)都顯現週期 為2層的振盪現象,而且其振盪幅度高達2%。 以上所敘述的電子密度泛兩理論的計算結果,都 與表面 X-射線繞射[13]、及低能電子繞射[14]的 實驗測量,互相一致。事實上,更令人驚奇的是 包括 Pb(111)薄膜的超導溫度[15]、及 Pb 原子在 Pb(111)薄膜上的擴散位壘(diffusion barrier) [16],



也都隨著薄膜厚度的增加,呈現 even-odd 的振 盪現象。從以上 Pb(111)薄膜的例子,可以立即 詢問的一個重要問題是:是否還有其它金屬薄膜 的量子尺寸效應可以觀察,並測量得到?答案當 然是肯定的。譬如,Ag 薄膜成長於 Fe(100)上, 其振盪週期約為 5.5 層[17]。另外一個明顯的例 子,則是 Al(111)的薄膜系統,因為其費米波向 量 k_F延著(111)方向的大小,使得(k_Fd/π) = 2.86, 非常接近 3 的緣故,這將導致 Al(111)薄膜的相 關物理性質,隨著薄膜厚度的增加,呈現週期為 3 層的振盪現象。圖四顯示 Al(111)薄膜的表面能 及功函數,兩者確實如預期,隨著薄膜厚度的增 加,呈現週期為 3 層的振盪現象。從 Pb(111)及 Al(111)薄膜系統的例子來看,是否可以說:所有 金屬薄膜的量子尺寸效應都可以觀察並測量得 到?答案應該是不必然如此,雖然量子尺寸效應 不管如何都會存在,但除非是費米波向量的半波 長與原子層的間距有相當簡單的整數比關係,否 則量子尺寸效應產生的效應,可能不容易顯現。

綜合以上的討論,當金屬薄膜厚度變薄至奈 米尺寸時,它們的基本性質受到量子力學效應的 影響變的顯著,尤其是當延著垂直於薄膜表面 『費米波向量的半波長與原子層的間距有相對 簡單的整數比關係』時,量子尺寸效應會變的非 常顯著,薄膜的許多特性,譬如功函數、表面能 等性質會隨著薄膜厚度產生明顯的振盪現象,而 且振盪的週期可由費米波向量的大小來決定。又 從觀察 Pb(111)及 Al(111)的薄膜系統可以知道, 即使在 15 或 20 個原子層的厚度時,系統仍然有 相當大的量子尺寸效應,這些事實顯示長久以來 學界使用於模擬表面研究的超晶格方法,由於使 用模擬表面之原子層數往往偏低,因此無法得到 正確地理論計算結果。

參考資料

- A.R. Smith, K.-J. Chao, Q. Niu and C.K. Shih, *Science*, 273, 226 (1996).
- [2] L. Gavioli, K.R. Kimberlin, M.C. Tringides, J.F. Wendelken and Z. Zhang, *Phys. Rev. Lett.*, 82, 129 (1999).
- [3] K. Budde, E. Abram, V. Yeh and M.C. Tringides, *Phys. Rev. B*, 61, R10602 (2000);
 V. Yeh, L. Berbil- Bautista, C.Z. Wang, K.M. Ho and M.C. Tringides, *Phys. Rev. Lett.*, 85, 5158 (2000).
- [4] M. Hupalo, S. Kremmer, V. Yeh, L. Berbil-Bautista and M.C. Tringides, *Surf. Sci.*, 493, 526 (2001); M. Hupalo and M. C. Tringides, *Phys. Rev. B*, 65, 115406 (2002).
- [5] W.B. Su, S.H. Chang, W.B. Jian, C.S. Chang, L.J. Chen and T.T. Tsong, *Phys. Rev. Lett.*, 86, 5116 (2001).
- [6] Z. Zhang, Q. Niu and C.K. Shih, *Phys. Rev. Lett.*, **80**, 5381 (1998).
- [7] F.K. Schulte, Surf. Sci., 55, 427 (1976).
- [8] I.B. Altfeder, K.A. Matveev, and D.M. Chen,

Phys. Rev. Lett., 78, 2815(1997).

- [9] M. M. Ozer, Yu Jia, B. Wu, Z. Zhang and H.
 H. Weitering, *Phys. Rev.* B, 72, 113409 (2005).
- [10] T.-C. Chiang, Surf. Sci. Rep., 39, 181 (2000).
- [11] C. M. Wei and M. Y. Chou, *Phys. Rev. B*, 66, 233408 (2002).
- [12] C. M. Wei and M. Y. Chou (unpublished).
- [13] P. Czoschke, H. Hong, L. Basile and T.-C.

Chiang, Phys. Rev. B, 72, 035305 (2005).

- [14] A. Mans, J. H. Dil, ARHF Ettema and H. H. Weitering, *Phys. Rev. B*, 72, 155142 (2005).
- [15] Y. Guo, et. al., Science, 306, 1915 (2006).
- [16] T. L. Chen, C. Wang, M. Hupalo, M. Tringides and K. M. Ho, *Phys. Rev. Lett.*, 96, 226102 (2006).
- [17] D. A. Lu, T. Muller, J. J. Paggel, M. Y. Chou and T. C. Chiang, *Science*, **292**, 1131 (2001).